統計干渉法による生物の成長計測-大気汚染物質の植物への影響-

Measurements of plant growth by statistical interferometry – Influence of air pollution on plants –

門野博史,大村明久,松井晃治,豊岡 了

Hirofumi KADONO, Akihisa OHMURA, Kohji MATSUI and Satoru TOYOOKA

Abstract: The statistical interferometry proposed and developed by the authors has been applied to measure the growth of plants, aiming at investigating the influence of environmental conditions on plants. This method utilizes the statistical properties of a fully developed speckle field and has the advantage of a simple optical system to achieve measurements with an extremely high accuracy. In experiments aimed at determining the validity of this method, the growth speeds of plants were measured under the exposure of ozone, which is the main substance of a photochemical oxidant. It has been clearly demonstrated that the statistical interferometry has a high sensitivity for monitoring the growth of plants on a nanometer scale with a high temporal resolution of a second scale.

Keywords: Statistical interferometry, Plant growth, air pollution, ozone, growth fluctuation

1. はじめに

近年,マイクロエレクトロニクスなどの分野に代表さ れる超精密加工技術の発達にともない,物体の形状や変 形などに対する高精度な計測技術の要求はますます増大 している.光学的干渉計測法はこのような要求に答えら れる現実的な手段である.光の波長を基準とするため, 物体の形状,変形,移動などを高精度に計測することが 可能である.干渉計測法の進歩は著しく,現在では光の 波長の数百分の1から数千分の1の精度での計測が可能 である¹⁾.一般的に,光学的干渉法では確定的な基準面 を設定し,基準面からの光波の波面を参照波として物体 からの光の波面の相対的な変化を読みとることにより物 体の情報を得ている.したがって,レーザースペックル

埼玉大学 大学院 理工学研究科 環境制御工学専攻 Graduate School of Science and Engineering, Saitama Univ., 255, Shimo-okubo, Sakura-ku, Saitama City, Saitama, 338-8570, Japan の発生や用いられる光学素子の加工誤差による波面の歪 みはただちに計測精度の低下につながる.このため、光 学素子を精密に作成することに多くの努力が払われるが、 実用環境下で長期に渡り精度を維持することは現実的に は難しい.

このような従来の確定的手法による光学的干渉法に対 して,著者らは発想を逆転し,ランダマイズされた参照 波面の干渉計測への影響を研究した.その結果,完全に ランダムな参照波面は統計的な意味において位相の基準 としての役割を果たし得ることを見いだした²⁾.この考 えに基づいて統計的干渉法を提案し発展させ,位相シフ トスペックル干渉法における位相シフト量の較正^{3,4)}, 粗面物体の面外・面内変位計測^{5,6)}およびひづみ計測⁷ に応用してきた.最近では植物の生長計測を試み、サブ秒 レベルでの生長の様子が観測されている⁸⁾.本稿では, この新しい概念に基づく超高感度干渉法である統計的干 渉法の原理を解説するとともに植物を通した環境センシ ングを目指して、環境汚染物質が植物の生長におよぼす



影響のモニタリングを試みた応用研究を報告する.

2. 統計的干渉法の原理

Fig.1に植物の生長計測に用いた実験光学系を示す. YAGレーザ (SHG) (波長 *l*=532nm) から直線偏光 で出射した光はビームスプリッタPBSにより2つのビ ームに分割されそれぞれミラーM。およびM。により反射 され再びPBSに入射する. この2本のビームをレンズ Lにより互いに平行とした後物体を2点で垂直に照明す る. ここで、物体表面は光学的に十分粗いとする. すな わち表面粗さが光の波長に比べて大きいとすると十分発 達した2つのスペックル場がそれぞれ独立に生じる.物 体法線から角度 θ の位置に置かれた C C D カメラにより 2つのスペックルパターンの重ね合わせの結果生じるや はりランダムな干渉パターンが計算機に取り込まれる. CCDカメラの前面に置かれた偏光フィルターPLは4 5°の偏光角に設定されており2つのスペックル場の干 渉成分のみを選択する.いま,照明ビームの間隔をxと し、2点間で*1* xの面内の伸長が起こると2つのスペッ クル場の間には次のような位相差Δ ωが生じる.

$$\Delta \phi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta x \sin \vartheta \tag{1}$$

植物の伸長に伴うランダムな干渉パターンの変化が逐次(*t=to, t1, ..., ta*)計算機に取り込まれ、フレームメモリに記録される. Fig.2(a)に粗面物体の伸縮に伴う位相の変化をフェーザー図で表す.目的はこれらフェーザー間の位相角を決定することである.ここで、取り込ま



Fig.2 (a) Object phases to determine expressed by means of phasors. (b) Combination of arbitrary three phasors

れた複数の画像から任意の3つの画像の組み合わせ(時 刻 *t=k1, k2, k3*)を考えよう. 簡単のために *t=k2のフェー* ザーが実軸上にくるように座標を回転しておく(Fig. 2 (b)). 3つの画像の強度を *I1, I2, I3*とおくとそれぞれ次 式で与えられる.

$$I_{1}(\mathbf{x}) = I_{o}(\mathbf{x})[1 + \gamma(\mathbf{x})\cos(\phi(\mathbf{x}) + \psi_{1})],$$

$$I_{2}(\mathbf{x}) = I_{o}(\mathbf{x})[1 + \gamma(\mathbf{x})\cos\phi(\mathbf{x})],$$

$$I_{3}(\mathbf{x}) = I_{o}(\mathbf{x})[1 + \gamma(\mathbf{x})\cos(\phi(\mathbf{x}) + \psi_{3})].$$
(2)

ここで. $L_0(x)$, $\gamma(x)$ はそれぞれ各点での平均強度,ビジビ リティーであり, $\phi(x)$ はランダムなスペックル位相である. Ψ_1, Ψ_3 は求めるべき物体変位に対応する位相である.3つ の方程式に対して5つの未知数が存在するので,連立方程 Eq.(2)からただちに Ψ_1, Ψ_3 を解くことはできない.そこで Ψ_1, Ψ_3 に対して次のように仮定する.

$$\psi_1 = \psi_3 = \psi. \tag{3}$$

ここでは **W**を仮想位相と呼ぶことにし、その値は任意に選 ぶことができる.このように未知数を見かけ上減少させる ことにより空間上の各点においてスペックル位相 øにつ いて解くことができる. Eq.(2)で与えられる3つの画像よ りスペックル位相は

$$\phi'(\mathbf{x}) = \tan^{-1} \frac{I_1(\mathbf{x}) - I_3(\mathbf{x})}{I_1(\mathbf{x}) + I_3(\mathbf{x}) - 2I_2(\mathbf{x})} \cdot \frac{\cos \psi - I}{\sin \psi}.$$
 (4)

で与えられる. Eq.(2)の仮定の元に計算されたスペックル 位相を真のスペックル位相 $\phi(\mathbf{x})$ と区別するために ここでは $\phi(\mathbf{x})$ としておき,計算されたスペックル位相 $\cdot z$ と呼ぶことにする. 我々は,各点におけるランダムなスペ ックル位相 $\phi(\mathbf{x})$ の具体的な値は知らないが,その統計的特 性は非常に良く知っている⁹. すなわち,スペックル位相 の確率密度関数 $\mathbf{p}_{\phi}(\phi)$ は次式で与えられるように $\cdot \pi$ か ら π にわたって一様に分布する.

$$p_{\phi}(\phi) = \frac{1}{2\pi}, \quad (-\pi < \phi \le \pi). \tag{5}$$

このような性質を持つスペックル場は十分発達したスペッ クル場と呼ばれ、スペックルパターンの明暗の程度を表す スペックルコントラストは最も大きくなり1となる.同時 に、その波面は全くランダムとなりスペックル位相は一様 に分布するのである.スペックル理論によるとそのような スペックル場の発生に必要な条件はレーザーで照射される 粗面の表面粗さが光の半波長程度かそれ以上であることが 要求されるだけである. 植物はもとより通常の身の回りの 物体の多くはこの条件を満たしている. この条件よりも表 面粗さが小さい場合スペックルコントラストは1より小さ い値を取る. このようなスペックル場は未発達なスペック ル場と呼ばれており、物体の表面粗さおよび表面高さ変動 の相関長(横方向の粗さ)や用いられる光学系の詳細なパ ラメータに複雑に依存することが知られている^{10,11)}.しか しながら、表面粗さの条件が満たされると、Eq.(5)で与えら れる特性は極めて安定であり高い精度で成り立つ.

一方,未知の物体位相 𝒯₁, 𝒯₃はいかなる値も取りうる ので Eq.(3)の仮定は一般には成り立たず不合理な仮定であ る.したがって, Eq.(4)で与えられる計算されたスペックル 位相は真のスペックル場の位相とは異なっている.計算さ れたスペックル位相 ϕ の確率密度関数 p_{ϕ} (ϕ) は確率変数 ϕ から ϕ への変換として次式を計算すること により容易に見い出される.

$$p_{\phi'}(\phi') = p_{\phi}(\phi) \left| \frac{d\phi(\phi')}{d\phi'} \right|.$$
(6)

Fig.3に理論計算結果の1例を示す.ここでは、見通し をよくするため物体位相 Ψ_I 、 Ψ_3 の仮想位相 Ψ からの偏 差を対称位相項 $\Delta \Psi_s$ および反対称位相項 $\Delta \Psi_a$ を用いて 表している.すなわち

$$\psi_{1} = -\psi - \Delta \psi_{s} + \Delta \psi_{a}, \qquad (7)$$

$$\psi_{3} = \psi + \Delta \psi_{s} + \Delta \psi_{a}. \tag{8}$$

である. Fig. 3 から- $\Psi_I = \Psi_3 = \Psi$ のとき,本来- π から π において一様に分布するべきスペックル位相の確率密度 が不均一に分布することがわかる. 特に,波長の100 分の1の比較的小さな位相成分でさえ顕著な影響を与え ていることは注目に値する (Fig. 3 (b) (c)). それで は,本来一様に分布する真のスペックル位相の確率密度 分布を基準として未知の物体位相 Ψ_I , Ψ_3 あるいは $\Delta \Psi_s$, $\Delta \Psi_a を決定することができないであろうか. 三角関数の$ 直交性を利用して,計算されたスペックル位相の確率密 $度分布から不均一分布成分である, <math>\cos 2\phi$ および $\sin 2$ ϕ 成分を抽出し,これらから未知の物体位相 Ψ_I , Ψ_3 に対して一意な解を見い出すことが可能である^{2,6)}. 我々 の目的は Fig. 2 (b) に示すすべてのフェーザー間の位 相角を決定することであるが,これは3つの画像の組み 合わせを換えながら同様な処理を繰り返すことによりお



Fig.3 Probability density distribution of evaluated speckle phase

こなわれる.

確定的な手法である従来法においては干渉計測精度の向 上とは確定的な波面を導入し、あらゆる誤差や揺らぎを排除 して精密に制御することであり、要求される精度が高くなるに したがって技術的にもコスト的にも大きな問題となる.さらに, 高精度化を達成する技術は用いられる光学系や要求精度 に強く依存し一様ではない.これに対して統計的干渉法で は位相の基準をスペックル場の完全なランダムさに求めてい る.すなわち,単に光学的に粗い表面をレーザー光で照射 することにより位相の基準が自然に作り出されるのである.十 分発達したスペックル場は一種の飽和した状態であるため, その特性は光学系に用いられるレンズや鏡などの光学素子 の面精度には依存せず安定した位相の基準として用ること ができる.

統計的干渉法では単に確率密度関数を求める際に用い られるデータサンプル数が計測精度を決定する.計算機 シミュレーションによると、約3万点のデータを用いる ことにより、高精度干渉法として知られるヘテロダイン 干渉法と同程度の *λ*/1000 の精度が達成されることがわ かる.今日では数百万画素のCCDカメラの利用も可能 であり、さらに高い精度での計測も可能である.

3. 植物の生長計測

これまでに統計干渉法を用いて金属などの材料の変位、 熱ひずみなどの測定に応用し、その有効性を確認してい る. 植物を対象とした計測では、植物の成長による伸長 を反映する表面からの散乱光を利用するため、植物内部 からの動的な散乱光すなわちバイオスペックルの影響を 抑制する必要がある.このために、植物表面に薄く小麦 粉を塗布し、照射光の植物内部への照明光の進入を阻止 した.

Fig.4に植物試料としてニラを用いた場合の生長測定 結果を示す.この場合2つの照射ビーム間隔は3.12mm で あり、葉の端から1cmおよび5cmの場所で測定を行った. 画像取り込みのフレームレート1fpsで数秒間にわたり成 長による伸びを測定した.図からわかるように、成長速 度は葉の先端から1cmでは18.8nm/sec、5cmでは



7.2nm/sec であり、葉の先端部分の成長速度が約 2.6 倍早 いことがわかる. これは葉の生長点が先端部分にあるこ とからも理解できる.

従来、植物の生長は数時間から数日間かかって計測さ れていた.すなわちこの間の積分値としてしか植物の挙 動を観測することしかできないが、極めて高感度な統計 的干渉計測法を用いることにより、秒レベルの高い時間 分解能でサブナノメータスケールの植物の挙動が観察可 能である.

我々はこの統計干渉法を用いて、環境汚染が植物に与 える影響の計測を試みている.ここでは、光化学オキシ ダントの主要物質であるオゾンの植物の生長に与える影 響を計測した例を示す.植物サンプルとしてはヤブラン を用いて 0.06ppm から 10ppm のオゾンを暴露し生長に与 える影響を観測した.Fig.5に日本の光化学オキシダント 注意報が発令される基準値である 0.12ppm および非常に 高濃度な例であるが 5ppm のオゾン濃度に対する生長速





度変化を示す. 各点での生長速度は10秒間に渡り20 フレームを取り込み算出した.これを15分間隔で暴露 前後でそれぞれ2時間および6時間半に渡り観測した. 0.12ppm のオゾン暴露実験に置いて、Time<0のオゾン暴 露前では平均生長速度 2.1nm/sec であった生長速度が暴 露開始後約1時間で0.48nm/secと約23%に大きく低下し ていることがわかる.この他特徴的なことは、暴露前の 健康な状態では生長速度は一定ではなく大きく揺らいで いることがわかる.この揺らぎは計測精度の不安定性で はなく、健康なサンプルでは必ず観測される挙動である. 著者が知る限り植物のこのような短時間での挙動は知ら れておらず、植物の生命活動の基本的性質を映し出して いるのではないかと考えている. 生長速度ゆらぎの標準 偏差で見ると暴露前には1.3nm/sec であったが暴露後で は 0.48nm/sec と大きく低下している. 高濃度の 5ppm に 対しては暴露開始後わずか15分後には伸長が負に転じ ていることがわかる.これは、細胞から水分が抜けるこ とにより一時的に収縮が起こっていると考えられる.現 在、植物のオゾンストレスの指標として生長速度ゆらぎ に注目し、研究を進めているところである.

4. むすび

本稿では、高感度な統計的干渉法を用いて植物の生長 計測を行った.これにより、秒オーダーでの植物の挙動 を観測することができ、これまでに知られていない植物 の世界が見えてきた.植物の成長速度が絶えず揺らいで いることもその一例であり新たな発見である.我々は本 手法を用いて、環境汚染が植物に与える影響を知り、さ らには植物を通した環境センシングへと発展させたいと 考えている.

計測法そのものについて言えば、干渉計測に限らず、 一般に計測において統計を用いると聞くとどのような印 象を持つだろうか.おそらく多くの方は、測定システム が不安定であったり、ノイズが多すぎるための苦肉の策 として多数回の測定を行い統計を用いて力ずくで値のバ タツキを押さえ込むと言うようなネガティブなイメージ を持つのではないだろうか.しかしながら、ここで述べ た計測法はランダムさそのものが本質的な役割を果たしている.この点が従来の計測法と決定的に異なる点であり、今後このような視点の元に新しい計測法が開拓されることを期待している.

参考文献

- P. Hariharan: *Optical Interferometry*, Academic press, Inc. (1985).
- 2) H. Kadono, and S. Toyooka: "Statistical interferometry based on a statistics of speckle phase," Opt. Lett., 16-12 (1991), 883-885.
- 3) 門野博史: スペックル干渉計における液晶位相シフタ ーの較正法,光学, 20-5 (1991), 273-274.
- H. Kadono, S. Toyooka, and Y. Iwasaki: "Speckle shearing interferometry using a liquid crystal cell as a phase modulator," J. Opt. Soc. Am, A8(1991), 2001-2008.
- 5) 門野博史,豊岡了:統計的干渉計測法による高精度変 位計測,光技術コンタクト, **32**-5(1994),17-23.
- 6) H. Kadono, Y. Bitoh, and S. Toyooka: "Statistical interferometry based on fully developed speckle field:An experimental demonstration with noise analysis," J. Opt. Soc. Am A, Vol.18, (2001),1267-1274
- 7) H. Kadono, H. Kitajima, and S. Toyooka: "Thermal strain mesurement of joint materials over a small spatiol region using statistical interferometry," Proc. 18th Congress of the International Commission for Optics(1999)741-742
- 8) H. Kadono, T. Nakamura, K. Matsui, and S. Toyooka, "Monitoring of biological activity and growth of plants using laser speckle techniques", Proc. VII International Conference on Optics within Life science (2003)(In press).
- 9) Dainty, J. C., ed.: Laser speckle and related phenomena, Springer-Verlag, Berlin(1975).
- H. Kadono, and T. Asakua: "Statistical properties of the speckle phase in the optical imaging system," J. Opt. Soc. Am. A2 (1985),1787-1792
- H. Kadono, N. Takai, and T. Asakua: "Statistical properties of the speckle phase in the diffraction region," J. Opt. Soc. Am. A3 (1986), 1080-1089.